トピックス

NEXAFS による窒化炭素薄膜の局所構造解析

下山巖

日本原子力研究所*

Local Structures Analysis of Carbon Nitride Films by Utilizing NEXAFS Spectroscopy

Iwao SHIMOYAMA

Japan Atomic Energy Research Institute

Nar edge X-ray absorption fine structure (NEXAFS) was used to investigate the local structures in carbon nitride (CN_x) films synthesized by ion implantation method. The N 1s NEXAFS spectra of CN_x film have shown three sharp π^* and one broad σ^* resonances whose intensities have clear polarization dependence. The polarization dependencies of the first and third π^* resonances have given similar tendency to that of the π^* resonance of graphite. While, the second π^* resonance has given different behavior. From the results, we concluded that the first, second, and third π^* resonances originate from pyridine-like structure, cyanic structure, and graphite-like structure, respectively. The results show the clear experimental evidence that there exists a graphite-like structure in which some of the carbon atoms are substituted by nitrogen atoms.

1. はじめに

まだ読んではいないが窒化炭素を題材にした SF 小説1) があるらしい。女子高生が偶然「空気よりも軽くダイヤモ ンドよりも硬い」窒化炭素を合成してしまい、会社を作っ て大儲けというなんだかあやかりたいような設定だが, 窒 化炭素という物質は一般にも次第に知られつつあるのかも しれない。それまでジシアンという猛毒のガスしか知られ ていなかった窒化炭素化合物 (CN_x) に対して、安定な固 体が形成される可能性を初めて指摘したのは、Liu と Cohen²)である。彼らの報告した β - C_3N_4 相はダイヤモン ドに匹敵する体積弾性率が予想されたため新たなコーティ ング材料として一気に注目をあびるようになった。この β $-C_3N_4$ は sp^3 の炭素と sp^2 の窒素から構成された六方晶で あり、窒化珪素 β -Si₃N₄ と同じ構造をとるが、これ以外に も様々な結晶構造が提案されている。ダイヤモンドより硬 いと考えられているのは sp3 の炭素と窒素から構成された 珪亜鉛鉱構造の立方晶 c- C_3N_4 であり、Teter と Hemley³⁾ の第一原理計算によればその体積弾性率は496 GPa とダ イヤモンドの実験値443 GPa4)よりも大きい。これが「ダ イヤモンドよりも硬い」イメージにつながったのだろう。 同じ立方晶ではダイヤモンド類似化合物とでも言うべき閃 亜鉛鉱構造の擬立方晶(pseudocubic-) C_3N_4 3)も提案され ているが、これは炭素のサイトでところどころ空孔のある 構造のため珪亜鉛鉱構造よりは少し柔らかいようだ。六方

晶では β-C₃N₄ のレイヤーがその鏡像層と AB スタッキン グ構造をとる α - C_3N_4 相があり、これは sp^3 の炭素と sp^2 の窒素から構成される3)。また他には sp2 の炭素と窒素か らできるグラファイト C_3N_4 がある $^{3)}$ 。これは炭素のサイ トで空孔のあるグラファイト類似化合物といえよう。Anders と Snis⁵⁾はこのようなグラファイト型 CN_x の電子構 造を計算し、 $C_{11}N_4$ の組成では金属的であるのに対し、 C_3 N_4 の組成においては約 $1.1\,\mathrm{eV}$ とシリコン並みのバンドギ ャップを持つ半導体になることを報告している。よってこ のグラファイト型 CN_x は原子一層の厚さしか持たない半 導体材料として興味深い。さらに Santos と Alvalez⁶⁾はグ ラファイトの炭素を窒素で置換していくと平面構造が次第 に歪んで CN ナノチューブやフラーレンのようなかご型分 子 $(C_{24}N_{32})$ になっていく可能性を指摘しており、この報 告は CN_x がナノデバイスとしても興味深い材料であるこ とを示している。また、そのほかにも菱面体晶 CN7)や、6 員環と5員環からなる架橋構造8)も提案されている。

このように興味深い性質を期待されている CN_x 材料を合成しようという試みは Liu & Cohen の指摘以来10年以上にわたって積極的に行われている。合成にはイオンビーム堆積法 0 やマグネトロンスパッタリング 10)などの非平衡反応による方法が用いられ,これらの方法は固溶限界を超えた窒素濃度をもつ材料合成に有力である。しかし現状のところ,理論的に予測されている CN_x の多くはその存在

^{*} 日本原子力研究所 放射光科学研究センター 表面化学研究グループ 〒319-1195 茨城県那珂郡東海村白方白根 2-4 TEL: 029-282-6823 FAX: 029-282-5832 E-mail: shim@popsvr.tokai.jaeri.go.jp

を実証する段階からまだ抜けきってはいない。合成された材料の殆どは非化学量論的なアモルファスであり,長距離構造が無いだけでなく幾つかの異なる局所構造が含まれた複雑な系であるため構造決定を非常に困難にしてきた。 β - C_3N_4 あるいは c- C_3N_4 の合成に成功したといういくつかの報告もなされているが $^{11-13}$, その大きさはナノスケールの微粒子であり, CN_x 薄膜中の構造にはまだ不明な点が多い。

このような現状ではまず局所構造を明らかにすることが 先決であり、X線光電子分光法(XPS)はこの目的で最 も広く用いられている。内殻準位は結合には関与しないも のの、周囲の局所的な化学的環境によってその結合エネル ギーをシフトさせる(化学シフト)ため、何らかの標準と 比較することにより、価数やイオン結合性についての知見 を得ることができる。しかし化学シフトは間接的な情報で あるため, その解釈にはある程度のあいまいさがつきまと う。CN_xの場合、後述するように XPS スペクトルの解釈 には多くの提案がなされ, 現在もなお議論が続いている。 一方, 吸収端近傍 X 線吸収微細構造 (NEXAFS) は XPS 同様、局所構造解析に有力な手法であるが、放射光実験と いうバリアーの高さのためか XPS ほど用いられてこなか った。NEXAFS は内殻から特定の空軌道への遷移に起因 するものであり、空軌道を直接プローブするため局所的な 化学状態を反映する。さらに放射光の偏光特性から軌道成 分を分離して観測することができるため、局所構造の立体 配置や配向に関する情報を直接得ることが可能である。こ れは XPS に無い大きな利点といえよう。そこで我々は NEXAFS とイオン注入法の組み合わせに注目した。CN_x 合成においてイオン注入法はイオンビームスパッタリング 法やrf スパッタリング法などと比べると生成物の窒素濃 度が低く, C₃N₄のように高窒素含有量が必要な材料合成 には不利な面があるため少々マイナーな観は否めないが、 入射イオンのエネルギーにより深さ方向に濃度傾斜をつけ ることや、出発物質を選択することで、ある程度生成物を 制御することも可能であるため依然として興味深い手法と いえよう。特にグラファイトを出発物質とした場合、その 2次元的な配向により、NEXAFS が顕著な偏光依存性を 示すことが期待されるので,他の合成方法にはない大きな 利点がある。本稿では NEXAFS を用いた CNx 薄膜中の 局所構造の研究を紹介し,新物質の構造解析における NEXAFS の有用性について論じる。

2. 実験

実験は高エネルギー加速器研究機構放射光施設(KEK-PF)の BL-11A と27A で行った。イオン注入のターゲットには c 軸の揃った Highly Oriented Pyrolitic Graphite (HOPG) を用いた。HOPG は大気中で清浄表面を出した後真空チェンバー内に導入し、 $\sim 10^{-7}$ Pa で $700\sim 800$ °C、3 分間の加熱を行った後イオン注入を行った。 CN_x 薄膜は

1 keV もしくは 3 keV の低エネルギー N_2^+ イオンを HOPG に対し直入射し、そのときのイオンフラックスの 典型値は 1×10^{13} atoms/s \bullet cm 2 であった。また照射時間を 変えることにより $10^{15} \sim 10^{17}$ atoms/cm 2 の範囲でフルエンスを制御した。

XPS の測定は BL-27A において行った。H や O などの 不純物の影響を避けるため XPS 測定は上記のように合成 した試料について in situ で行った。光源として hv = 1.8keV の単色軟 X 線を用い、Tanuma, Powell, Pennの式¹⁴⁾ から見積もったこのときの C1s, N1s 光電子の平均自由行 程はそれぞれ約4.0,3.7 nmである。試料中の窒素濃度 は、半球型アナライザーを用いて得られたスペクトルの N1s, C1s 光電子ピークの強度比と hv = 1.8 keV のフォト ンの吸収断面積,及び平均自由行程から求めた。また,比 較のために Fig. 1 にしめす標準物質についても XPS スペ クトルを測定した。このうち pyridine (参照データ¹⁵⁾) と triazine 中の N は sp², triethylamine と hexamethylenetetramine 中のNは sp^3 とそれぞれ異なる立体配置をとる。 XPS 測定において triazine, triethylamine は Cu(100)上の 凝縮系を用い、hexamethylenetetramine は粉末試料を用 いて測定を行った。

NEXAFS 実験は BL-11A で行った。NEXAFS 実験についても同様に *in situ* で測定を行い,試料電流法を用いてスペクトルを得た。N K端の NEXAFS スペクトルについてはイオン注入前の HOPG のバックグラウンドスペクトルとの差を取ることによって求めた。また試料の法線方向と電場ベクトルとのなす角で定義される入射角 θ を 10° (斜入射) から 90° (直入射) まで変えながら NEXAFS

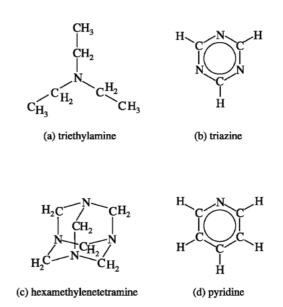


Figure 1. Standard materials having C-N bonds. Nitrogen atoms in (a): triethylamine (TEA) and (c): hexamethylenetetramine (HMTA) have sp^3 configuration. Nitrogen atoms in (b): triazine (TA) and (d): pyridine have sp^2 configuration.

の偏光依存性を測定した。ところでイオン注入法では,必ずイオン照射による損傷が生じるためフルエンスが増すと共に次第にグラファイトの配向性が失われる。そこでNEXAFS スペクトルの偏光依存性に関する測定は $\sim10^{15}$ atoms/cm² の低フルエンスでの試料について行った。さらに構造変化を調べるため $200\sim1000$ でまで温度を変えながらアニールを行い,それぞれの温度に対し3分間のアニール後 NEXAFS スペクトルを測定した。

3. CN_x 薄膜の局所構造

3.1 XPS による解釈

まず、XPS からどのようなことがわかるかをみてみよう。 **Figure 2** に [N]/[C] = 0.23の CN_x 薄膜の N1s XPS スペクトルを示す。 Gaussian(点線)で示したように 3 つの明瞭な成分 P_1 (E_B =398.3 eV), P_2 (E_B =400.3 eV), P_3 (E_B =402 eV) が観測された。この結果からまず薄膜中に異なる化学状態にある N サイトが複数存在することがわかるが,実は他の方法で合成された CN_x の XPS スペクトルにも同様のピーク成分が観測されている。合成方法によらない共通のピークはユニバーサルな窒素の局所構造の

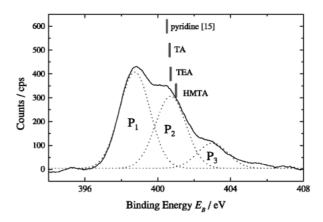


Figure 2. N 1s XPS spectrum of the CN_x film for $\lceil N \rceil / \lceil C \rceil$ ratio of 0.23. Solid and broken lines show the experimental result and Gaussian functions which are used for peak fitting, respectively. The peak energies of P_1 , P_2 , and P_3 are 398.3, 400.3, and 402.6 eV, respectively. Vertical lines show the N 1s binding energies of reference materials.

存在を示唆しているが、これらのピークに対してこれまで Table 1 に示したように様々な解釈が提案されてきた。こ

Table 1. The peak energies of N 1s XPS spectra of CN_x films prepared by various kinds of synthesis methods. The assignments for the peak components are also listed in the table

	Synthesis Method	Peak Energies in N 1s XPS Spectra (eV)	Assignment
Marton et al. ²⁸⁾	ion beam deposition	398.3	sp³ bonded N
		400.0	sp ² bonded N
		402.0	N ₂ or NO
		398.1 ∼399	tetrahedral N (sp³)
Sjöström et al.8)	dc magnetron sputtering	~399 400.0 ~402	Graphite-like hexagonal N (sp²) not N–O
Zheng et al. ²⁷⁾	dc magnetron sputtering	398~398.3	sp ³ bonded N
		398.9	nitrile group $(-C \equiv N)$
		400.0~400.7	sp ² bonded N
		~402	NO
Ronning et al. ²⁹⁾	ion beam deposition	~398	three-carbon coordinated N
		\sim 400	two-carbon coordinated N
Holloway et al. ³⁰⁾	dc magnetron sputtering	~398.5	three-carbon coordinated N
		~401	four-carbon coordinated N
Galán et al. ³¹⁾	ion implantation	398.7	nitrile group $(-C \equiv N)$
		399.7	metastable
		400.7	imine type $(> C = N-)$
		402.4	N_2
Quirós et al. ³²⁾	dual ion beam sputtering	399.3	nitrile group $(-C \equiv N)$ and
		401.3	graphite-like structure
		403.6	N ₂ or NO
		405.9	
Kim et al. ³³⁾	plasma enhanced CVD	398.3	NH _y
		400.2	CN_x
		402.2	NO

のうち N-O あるいは N-H への帰属は in situ で測定した 我々の XPS スペクトルにも同様のピークが観測されるこ とから除外することができるが、主な成分である P_1 、 P_2 が立体配置の違いに起因するものか、配位数の違いによる ものかが大きな問題である。これに対し我々は標準試料と の比較を行い、Fig. 2 に示すように全ての標準物質の結 合エネルギー E_B が近い値を持ち、 P_2 のエネルギー領域に 偏っていることを明らかにした。Siegbahn のモデル¹⁶⁾に 従って C=N2 重結合を 2 本の C-N 結合と勘定すると、こ こで用いた標準試料中の全てのNは3つのC-N結合を持 つことになり、これを反映して Fig. 2 の結果が得られた と考えられる 17 。このことから少なくとも **Table 1** の帰 属のうち sp^3 , sp^2 や tetrahedral, hexagonal などの立体配 置によるものを除外できるが、我々の結果では P_1 や P_3 に対応する標準試料がなく、これらのピークがどのような 局所構造に起因したものなのか依然不透明なままである。 そこで次に NEXAFS を用いて調べてみることにしよう。

3.2 NEXAFS による解釈

Figure 3(a) に 3.4×10^{15} atoms/cm² の低フルエンスで 合成した CN_x 薄膜 ([N]/[C]≤5%) の窒素 K 吸収端 (N1s) NEXAFS スペクトルの偏光依存性を示す。 hv = 398.3, 399.5, 400.7 eV に 3 つのシャープなピーク a, b, c が、hv = 407 eV にブロードなピーク d が観測された。こ れらのピークはアークジェット法18)やマグネトロンスパ ッタリング¹⁹⁾により合成された CN_x 薄膜の NEXAFS ス ペクトルにも観測されており、XPS と同様他の合成方法 においても存在するユニバーサルな局所構造に起因したも のである。しかしその解釈については XPS 以上に不明な 点が多く, ほとんどわかっていない。これは NEXAFS が 内殻準位の化学シフトという始状態効果だけでなく、内殻 正孔ポテンシャルの効果などの終状態効果によっても影響 を受けるため、その解釈が単純ではないことによる20)。 ところが興味深いことに我々の試料の NEXAFS スペクト ルは明瞭な偏光依存性を示した。この結果はイオン注入の 出発物質として用いた HOPG がそろった配向を持つこと によると考えられる。よってこれを手がかりに各ピークの 帰属について以下考察しよう。

スペクトル中のシャープなピーク a, b, c は斜入射になるにつれ強度が大きくなり,直入射で小さくなる偏光依存性を示した。一方ピーク d はこれとは逆の傾向を示す。また,スペクトル形状は $600\sim700^{\circ}$ ℃付近のアニールにより変化し始め, 840° ℃でアニールした試料では,NEXAFSスペクトルの偏光依存性はさらにはっきり観測されるようになった(Fig. 3(b))。Figure 4 の \Box , \triangle , \bigcirc のプロットは放射光の偏光方向と試料の法線方向とのなす角に対するピーク a, b, c のそれぞれの強度をあらわす。Figure 4 (a)に示すようにアニール前の試料ではピーク a, b, c の偏光依存性は似た傾向を示した。一方,アニール後(Fig. 4

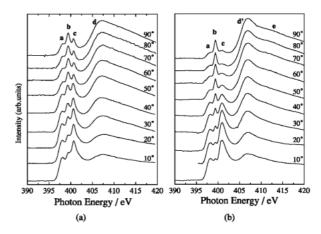


Figure 3. (a) N 1s NEXAFS spectra of CN_x film prepared by 3 keV nitrogen ion implantation at the N_2^+ fluence of 1.7×10^{15} ions/cm² without annealing. From the bottom to top, curves show the results from grazing incidence to normal incidence. (b) The same as Fig. 3 (a) for the CN_x film after annealing at 840°C for 3 minutes.

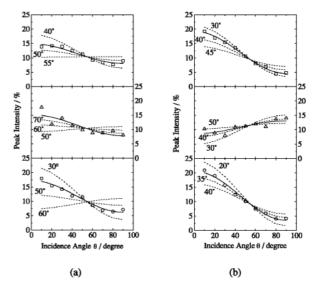


Figure 4. (a) Polarization dependence of the intensities of the π^* resonances in the N 1s NEXAFS spectra before annealing. Marks \Box , \triangle , and \bigcirc show the normalized peak intensity ratios of the peaks a, b, and c in the N 1s NEXAFS spectra of Fig. 3(a). Solid lines show the best fit results of theory and broken lines show the reference curves for various polar angles α and γ . (b) The same as Fig. 4 (a) for the N 1s NEXAFS spectra after 840°C annealing procedure.

(b))はピーク a, c が同じ傾向を強めるのに対しピーク b は僅かながら逆向きの偏光依存性を示した 21)。これらのピークの帰属を考える前に NEXAFS の偏光依存性について簡単に説明する。軽元素の NEXAFS ピーク強度 I は 1 s 軌道から空軌道への双極子遷移によって表される 22)。

$$I \propto |\langle f | \mathbf{E} \cdot \mathbf{p} | i \rangle|^{2}$$

$$= |\mathbf{E} \cdot \langle f | \mathbf{p} | i \rangle|^{2}$$
(1)

ここで E は X 線の電場ベクトル,p は電子の運動量演算子, $|i\rangle$ は 1s 始状態, $\langle f|$ は終状態を表す。行列要素 $\langle f|p|i\rangle$ は遷移先の軌道ベクトル O の方向を示すため,E と O が大きい射影をなすとき遷移強度 I は強められる。つまり,

$$I \propto \cos^2 \delta$$
 (2)

ここで δ はEとOのなす角である。 π *空軌道と σ *空 軌道は互いに直交しているため、NEXAFS スペクトルに おいて π^* ピークと σ^* ピークは互いに逆の偏光依存性を示 す。例えば(0001)面が表面の HOPG の場合, π^* の軌道べ クトルが表面法線方向を向いているため C 1s NEXAFS において π^* ピークは斜入射で強められ, σ^* ピークは逆に 直入射で強められる²³⁾。このことより Fig. 3 の NEXAFS スペクトルにおいても π^* と σ^* ピークが存在していること は明らかである。また、Plashkevych ら²⁴⁾による様々な CN_xのNEXAFS 理論計算によれば,405 eV 付近より高 エネルギー側で現われる σ *ピークに対し, π *ピークはそ れよりも低いエネルギー領域に位置することが報告されて いる。以上の結果から**Fig. 3**のピークa, b, c は $1s \rightarrow$ π^* , ピーク d は $1s \rightarrow \sigma^*$ 遷移に帰属される。この結果から この薄膜中に C-Nπ 結合を持つ (π 共役系の) 局所構造が 存在するということがわかった。ここで注目すべきことは, π 共役系は π 結合と共に σ 結合も持つため、 π 共役系の局 所構造に起因した NEXAFS には互いに逆の偏光依存性を 示す π *ピークと σ *ピークが存在するということである。 一方、ダイヤモンド構造のように立体的に等価な sp^3 の σ 結合に起因した σ *ピークは入射角に依存せずほぼ一定の ピーク強度を示す。**Figure 3** において σ^* ピークは明瞭な 偏光依存性を示し, 斜入射でその強度は非常に抑制された。 NEXAFS のこのエネルギー領域には偏光依存性を持たな い連続帯が存在することを考慮すると、この結果はCN_v 薄膜中でsp3立体配置をとるNがあまり存在していない ことを示唆している。

次に π 結合を持つ N の局所構造を考えてみよう。この CN_x 薄膜の低い窒素濃度($[N]/[C] \le 5\%$)から大多数の 窒素は炭素のみと結合していると考えられるので,N の局所構造としては Fig.5 に示すように(a) 3 重結合,(b) 2 重結合,(c) 単結合による 3 つの系が挙げられる。しかしこれらの構造が 3 つのピークのどれかに対応すると簡単に結論づけることはできない。というのはピーク a, b, c が同じ π 共役系の局所構造に起因したものである可能性もあるからである。例えばベンゼンの C 1s NEXAFS スペクトルには $\pi^*(e_{2u})$ と $\pi^*(b_{2g})$ という二つの π^* ピークが存在し,これは同じ構造による異なる軌道成分である。しかし,上記の局所構造のうち,同じ構造に起因する π^* ピークであればその偏光依存性は同じ傾向を示すはずなので,アニール後互いに異なる偏光依存性を示した

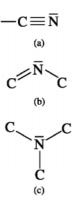


Figure 5. Possible configurations of nitrogen local structures in carbon network with one, two, or three neighbors.

ピーク a, c とピーク b はそれぞれ異なる局所構造に起因していると言える。ところでグラファイトの結晶構造をベースにしたときこれらの局所構造中で(b)はピリジン構造として、また(c)はグラファイト構造としてグラファイトシート(グラフェン)内に入ってグラファイトと同じ配向をとりうるが、(a)のシアン構造だけはグラフェン面内に入り得ないためその両者とは異なった配向を持つであろう。この結果はピーク b がシアン構造に起因する π^* ピークであることを強く支持する。

一方でピーク a, c はどちらも似た偏光依存性を示すが,この二つは同じ局所構造に起因したものなのだろうか? この問題を取り扱うためにも,各ピークの偏光依存性についてもう少し定量的に議論しよう。 π *軌道にはベクトル型と平面型の 2 種類があり,それぞれの偏光依存性の理論式は次の(3),(4)式のように表される 22)。

$$\begin{split} I(\theta) = & A \left\{ \frac{P}{3} \left[1 + \frac{1}{2} (3 \cos^2 \theta - 1) (3 \cos^2 \alpha - 1) \right] \right. \\ & \left. + \frac{(1 - P)}{2} \sin^2 \alpha \right\} \end{split} \tag{3} \\ I(\theta) = & B \left\{ \frac{2P}{3} \left[1 - \frac{1}{4} (3 \cos^2 \theta - 1) (3 \cos^2 \gamma - 1) \right] \right. \end{split}$$

$$I(\theta) = B \left\{ \frac{2P}{3} \left[1 - \frac{1}{4} (3\cos^2 \theta - 1) (3\cos^2 \gamma - 1) \right] + \frac{(1-P)}{2} (\cos^2 \gamma + 1) \right\}$$
(4)

ここで A, B は入射角積分した吸収断面積であり,P は偏光度(=0.95), α はベクトル型の π^* 軌道ベクトル O と試料法線とのなす角度, γ は平面型の π^* 軌道の法線ベクトル N と試料法線とのなす角度である。Figure G(a), G(a) にそれぞれの角度の関係を示す。ピリジン構造とグラファイト構造の G(a) が、G(a) が、G(

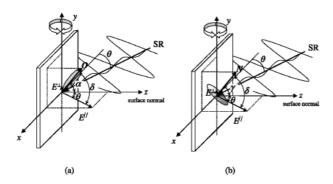


Figure 6. (a) Coordination system defining of a π^* vector orbital on the surface. The polar angle α is defined as an angle between the π^* orbital vector O and surface normal z. The electric field vector of synchrotron radiation is divided into horizontal component $E^{//}$ and vertical component E^{\perp} , and the polarization factor P is defined as $P \equiv |E^{//}|^2/(E^{//}|^2 + E^{\perp}|^2)$. The incidence angle θ is defined as an angle between $E^{//}$ and surface normal, and δ is defined as an angle between O and $E^{//}$. (b). The same as Fig. 6(a) for π^* plane orbital on the surface. The polar angle γ is defined as an angle between the π^* plane normal N and surface normal z.

の最終的な理論曲線(実線)と様々な配向を想定した理論 曲線(破線)を示す。その結果、アニール前にはピークa に対し $\alpha=46^{\circ}\pm5^{\circ}$, ピークcに対し $\alpha=40\pm5^{\circ}$, ピークb に対し $\gamma = 85 \pm 15$ °の値を得た。アニール後これらの値は 変化し、ピークaに対し $\alpha=34\pm5^{\circ}$ 、ピークcに対し $\alpha=$ $30\pm5^{\circ}$, ピークbに対し $\gamma=44\pm5^{\circ}$ の値を得た。アニール の前後でピーク a, c の α値が減少しているのはイオン照 射によるグラファイト結晶の損傷が次第に回復しているこ とを意味していると考えられる。一方、ピークbの γ 値 は大きく変化し, アニール後シアン構造がグラファイト面 に対し斜めに立った配向をもつことことがわかった。ま た,ピークa,cの比較において注目すべきことはアニー ルの前後においてピーク a, c がわずかに異なる偏光依存 性を示していることである。この結果は両者がそれぞれ異 なる配向を持った軌道成分であることを意味している。さ らに決定的なのはアニールによる変化である。Figure 7 に840 $^{\circ}$ (**Fig. 7(a)**) と1100 $^{\circ}$ (**Fig. 7(b)**) の異なる温 度でアニールした試料の N 1s NEXAFS スペクトルを示 す。実線は斜入射 ($\theta=10^\circ$), 破線は直入射 ($\theta=90^\circ$) の データを表す。840℃のときと比べ1100℃の高温でアニー ルしたときのほうがピークa,c共にグラファイト的な偏 光依存性がさらに強められており、イオン照射による損傷 が回復し結晶の配向が良くなっていることがわかるが、よ り注目すべきはピークaにたいするピークcの強度比が大 きくなっていることである。仮にピークaとcが同じ局所 構造に起因した π *ピークであるならばアニールにより配 向が変化したとしてもその相対比は変化しないはずなの で、これら結果よりピークaとcも異なる局所構造に起因 したものであると結論できる。

厳密には NEXAFS ピーク強度比の変化は、それぞれの

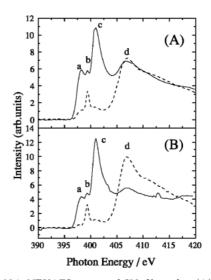


Figure 7. N 1s NEXAFS spectra of CN_x films after (A) 840°C and (B) 1100°C annealing for 3 minutes. Solid and dotted lines show the spectra for grazing $(\theta\!=\!10^\circ)$ and normal $(\theta\!=\!90^\circ)$ incidence, respectively.

ピークに対応する局所構造の①組成比と②配向の変化両方の影響によるものなので,ここからすぐにピーク c に対応する局所構造の組成比が,より高温のアニールにより大きくなっていると結論することはできない。しかし,入射角度をうまく設定してやれば配向による影響を排除することができる。 Figure 4 からわかるように $\theta=55^\circ$ 付近で系の配向によらずピーク強度が交差する点が存在する。これは魔法角(magic angle)として知られているもので,正確には $\theta=54.7^\circ$ においてランダム配向と同じ状況での相対的なピーク強度が観測される $^{22)}$ 。このため魔法角でのピーク強度を求めることにより偏光依存性による影響を除外した比較を行うことが出来る。そこで我々は Fig. 7 のピーク a とピーク c の両方のピークについて, $\theta=10^\circ$ と $^\circ$ 20 $^\circ$ のそれぞれスペクトルにおけるピーク強度の平均値 I_{Av} を求め,さらにこの平均値の比を求めた。つまり,

$$I_{Av.}^{\rm peak}(T) = \frac{I_{10} + I_{90}}{2} \tag{7}$$

$$\frac{I_{Av.}^{\text{peak a}}(840)}{I_{Av.}^{\text{peak c}}(840)} \approx 0.54$$

$$\frac{I_{Av.}^{\text{peak a}}(1100)}{I_{Av.}^{\text{peak c}}(1100)} \approx 0.36 \tag{8}$$

ここで I_{Ae}^{peak} はアニール温度 T における各ピークのピーク 強度平均値である。この結果より明らかにピーク c に対応する局所構造の比率が1100 C のアニールによって増していることがわかった。アニールによりグラファイトの結晶構造が回復したことを考慮すると,ピリジン構造は次第にグラファイト構造に変化していくと考えられるのでピーク a はピリジン構造,そしてピーク c はグラファイト構造に

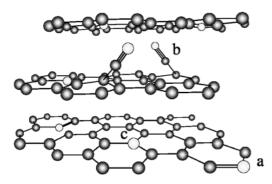


Figure 8. Schematic diagrams of CN_x local structures in graphite matrix. Dark balls and white balls show graphite and nitrogen atoms, respectively. a: pyridinelike structure b: cyanic structure c: graphitelike structure.

起因した π^* ピークであると帰属される $^{26)}$ 。 Plashkevych ら $^{21)}$ の STEX 理論計算によれば, CN_x 化合物の N1s NEXAFS においてピリジン構造の π^* ピークが最も低いエネルギーに現われ,次にシアン構造の π^* ピーク,グラファイト構造のように炭素が 3 配位した N による π^* ピークが最も高エネルギー側に現われる。この結果は我々の解釈を支持している。

以上の結果から CN_x 薄膜中の構造を眺めてみることにしよう。 Figure 8 の模式図に示したように,ピリジン構造とグラファイト構造はグラフェン面内に入ってグラファイトと同じ配向をとり,シアン構造はグラフェンと C-C 単結合で結合するため特定の方向を向くことができず,グラファイトの層間で様々な方位角をもって(つまりランダムな配向で)存在していると考えられる。このためシアン構造に対応するピーク b はあまり大きな偏光依存性を示さないのだろう。また,ピリジン構造の N のサイトではグラファイトネットワークが途切れているため,グラファイト構造に比べ若干自由度が存在する。これがピリジン構造とグラファイト構造の α 値の僅かな違いとなって表れていると解釈することができる。

4. まとめ

 CN_x 薄膜はその合成方法や合成に関する様々なパラメータによりその組成・構造を大きく変える。よって合成条件探索のためには XPS スペクトルや NEXAFS スペクトルに観測されるピークが何に帰属されるのかという分光学的な基礎研究が非常に重要なのは言うまでも無い。 XPS ではなかなか明らかにできなかったこの問題に対し、我々は NEXAFS スペクトルの偏光依存性から、薄膜中にピリジン構造、シアン構造、グラファイト構造の3つの局所構造が存在することを明らかにした。以上一例ではあるが、 CN_x のような新物質の構造解析に対する NEXAFS 分光法の有用性を示した。近年、物性研究において新物質創製は一つの大きなキーワードとなってきているが、この面からも NEXAFS を用いた研究はますます増え

ていくことだろう。今後、 CN_x ばかりでなくさらに新奇な物質の構造解析にこの手法を用いて展開していきたいと考えている。

5. 謝辞

本稿で紹介した内容は KEK-PF の共同利用実験課題番号99G247の研究テーマとして、日本原子力研究所の表面化学研究グループの馬場祐治グループリーダー、関口哲弘研究員、また中国科学技術大学の Wu Guohua 博士との共同研究により行われた。また BL-11A の北島義典博士、また BL-27A の小林克巳助教授をはじめ PF のスタッフおよび原研スタッフの方々に感謝いたします。

参考文献

- 1) 野尻抱介: ふわふわの泉 (ファミ通文庫, 2001).
- 2) A. Y. Liu and M. L. Cohen: Science **245**, 841 (1989).
- 3) D. M. Teter and R. J. Hemley: Science 271, 53 (1996).
- 4) A. Y. Liu and M. L. Cohen: Phys. Rev. **B 41**, 10727 (1990).
- 5) A. Snis and S. F. Mater: Phys. Rev. B 60, 10855 (1999).
- 6) M. C. Santos and F. Alvalez: Phys. Rev. **B** 58, 13918 (1998).
- 7) M. Côté and M. L. Cohen: Phys. Rev. **B** 55, 5684 (1997).
- 8) H. Sjöström, S. Stafström, M. Boman and J.-E. Sundgren: Phys. Rev. Lett. **75**, 1336 (1995).
- D. Marton, K. J. Boyd, A. H. Al-Bayati, S. S. Todorov and J. W. Rabalais: Phys. Rev. Lett. 73, 118 (1994).
- H. Sjöström, I. Ivanov, M. Johansson, L. Hultman, J.-E, Sundgren, S. V. Hainsworth, T. F. Page and L. R. Wallenberg: Thin Solid Films 246, 103 (1994).
- N. Chunming, Y. Z. Lu and C. M. Lieber: Science 261, 334 (1993).
- Y. Tani, Y. Aoi and E. Kamijo: Appl. Phys. Lett. 73, 1652
 (1998)
- K. Yamamoto, Y. Koga, K. Yase, S. Fujikawa and M. Kubota: Jpn. J. Appl. Phys. 36, Pt. 2, L230 (1997).
- 14) 徳高,石原,西守,岸田,高淵:表面科学 11,48 (1990).
- 15) A. Mansour and D. Ugolini: Phys. Rev. **B** 47 (1993) 10201.
- 16) K. Siegbahn, C. Nordling, A. Fahlman, R. Nordberg, K. Hamrin, J. Hedman, G. Johansson, T. Bergmark, S. E. Karlsson, I. Lindgren and B. Lindberg: ESCA-Atomic, Molecular, and Solid State Structure Studies by Means of Electron Spectroscopy, Nova Acta Regiae Soc. Sci., Ups. 4 (1967) 20.
- I. Shimoyama, T. Sekiguchi and Y. Baba: Jpn. J. Appl. Phys. 39, Pt. 1, 4541 (2000).
- 18) I Jimenez, W. M. Tong, D. K. Shuh, B. C. Holloway, M. A. Kelly, P. Pianetta, L. J. Terminello and F. J. Himpsel: Appl. Phys. Lett. 74, 2620 (1999).
- 19) J.-H. Guo, W. T. Zheng, C. Sathe, N. Hellgren, A. Agui and J.-E. Sundgren: J. Elect. Spectrosc. Relat. Phenom. 101– 103, 551 (1999).
- H. Oji, R. Mitsumoto, E. Ito, H. Ishii, Y. Ouchi, K. Seki, T. Yokoyama, T. Ohta and N. Kosugi: J. Chem. Phys. 109, 10409 (1998).
- I. Shimoyama, G. Wu, T. Sekiguchi and Y. Baba: Phys. Rev. B 62, R6053 (2000).
- 22) J. Stöhr: NEXAFS Spectroscopy, (Springer, Berlin, 1996).
- 23) R. A. Rosenberg, P. J. Love and V. Rehn: Phys. Rev. **B** 33,
- O. Plashkevych, A, Snis, L. Yang, H. Ågren and F. Mater: Phys. Scr. 63, 70 (2001).

- J. L. Solomon, R. J. Madix and J. Stöhr, Surf. Sci. 255, 12
 (1991)
- I. Shimoyama, G. Wu, T. Sekiguchi and Y. Baba: J. Elect. Spectrosc. Relat. Phenom. 114-116, 841 (2001).
- 27) W. T. Zheng, K. Z. Xing, N. Hellgren, M. Lögdlund, Å. Johansson, U. Gelivs, W. R. Salaneck and J.-E. Sundgren: J. Elect. Spectrosc. Relat. Phenom. 87, 45 (1997).
- D. Marton, K. J. Boyd, A. H. Al-Bayati, S. S. Todorov and J. W. Rabalais: Phys. Rev. Lett. 73, 118 (1994).
- 29) C. Ronning, H. Feldermann, R. Merk, H. Hosfsass, P.

- Reinke and J.-U. Thiele: Phys. Rev. B 58, 2207 (1998).
- 30) B. C. Holloway, O. Kraft, D. K. Shuh, M. A. Kelly, W. D. Pianetta and S. Hagstrom: Appl. Phys. Lett. 74, 3290 (1999).
- L. Galan, I. Montero and F. Rueda: Surf. Coat. Technol. 83, 103 (1996).
- C. Quiros, J. G. Garcia, F. J. Palomares, L. Soriano, E. Elizalde and J. M. Sanz: Appl. Phys. Lett. 77, 803 (2000).
- 33) J. H. Kim, D. H. Ahn, Y. H. Kim and H. K. Baik: J. Appl. Phys. 82(2), 658 (1997).

-ロメモ

アオキ

ミズキ科アオキ属の常緑性低木で,葉は厚くつやがあり,長さ $8\sim20~{\rm cm}$,幅 $2\sim10~{\rm cm}$ で荒い鋸葉がある。日陰でもよく生長するので,庭木や公園樹として利用される。花は晩春に紫褐色に咲き,実は冬に赤色となる。生葉はあぶって泥状とし,やけどやきり傷に塗ったり,そのエキスは凍傷などに効果があると言われている。また,動物とのかかわりは深く,枝や葉はカモシカが,実はヒヨドリをはじめとする鳥が好んで食べる。そのため,種子が各地に運ばれ,身近な場所で見られる。

暗いニュースが多い昨今ですが、白川先生、野依先生と2年連続のノーベル化学賞受賞は明るいニュースで、若者に科学の楽しさ・面白さを伝えるのに多いに役に立っています。

(No. 43, K. Ohshima)

